

2010年3月期決算説明会

2010年5月28日
株式会社ホロン
JQ7748

Solutions for Mask & Wafer Metrology

INDEX

1. 2010年3月期決算の概要
2. 2011年3月期の業績見通し
3. シームレスモールドステッパー
4. 高速EB検査装置の新開発

1. 2010年3月期決算の概要

当期損益(対予想比)

(単位:百万円)

	当初予想	10年3月期	対予想比	
	金額	金額	増減額	増減比(%)
売上高	1,010	1,151	141	14.0%
営業利益	38	30	△ 8	△21.1%
経常利益	35	41	6	17.1%
当期純利益	27	39	12	44.4%

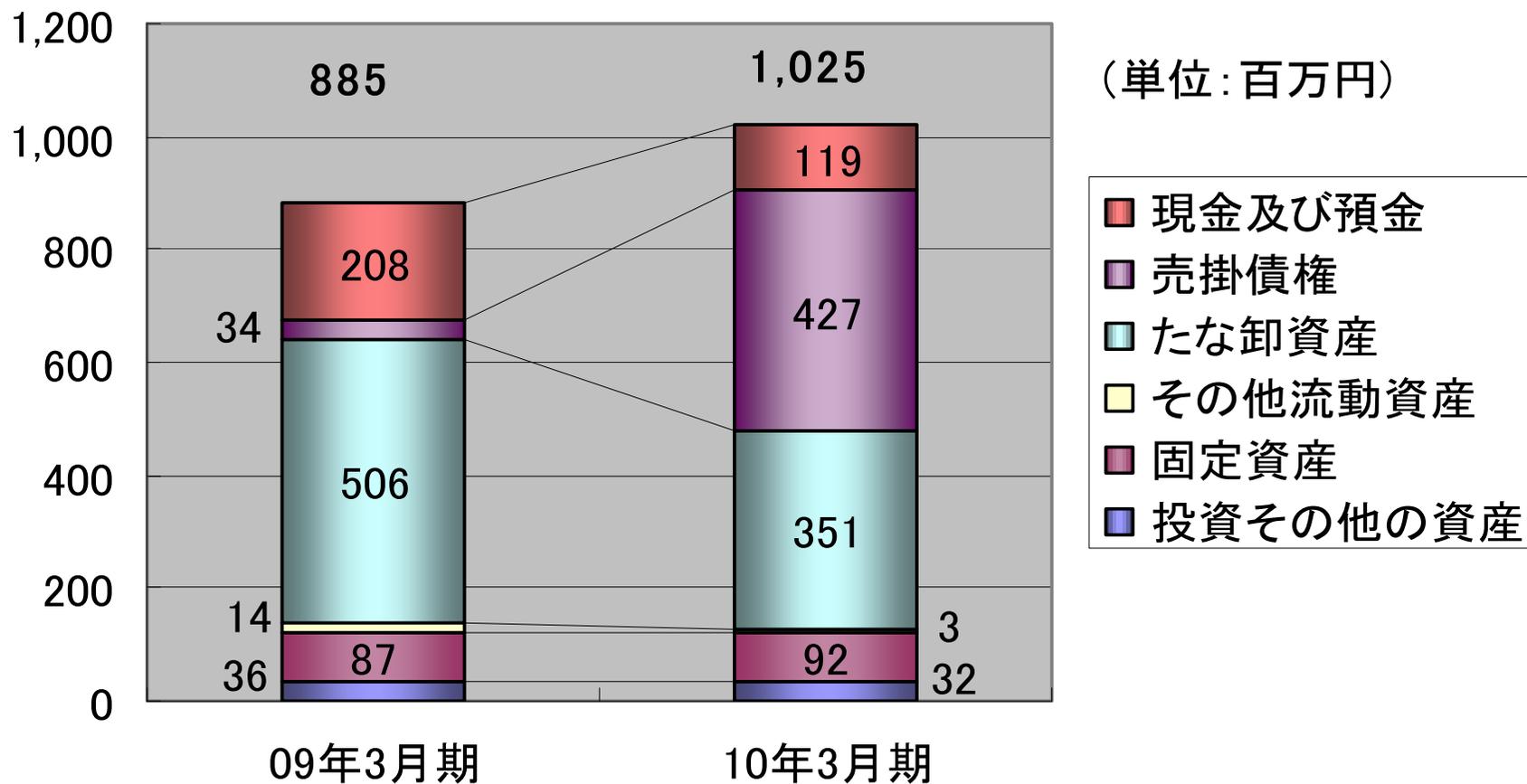
当初予想:平成21年5月12日に公表した数値を使用しております。

当期損益(対前期比)

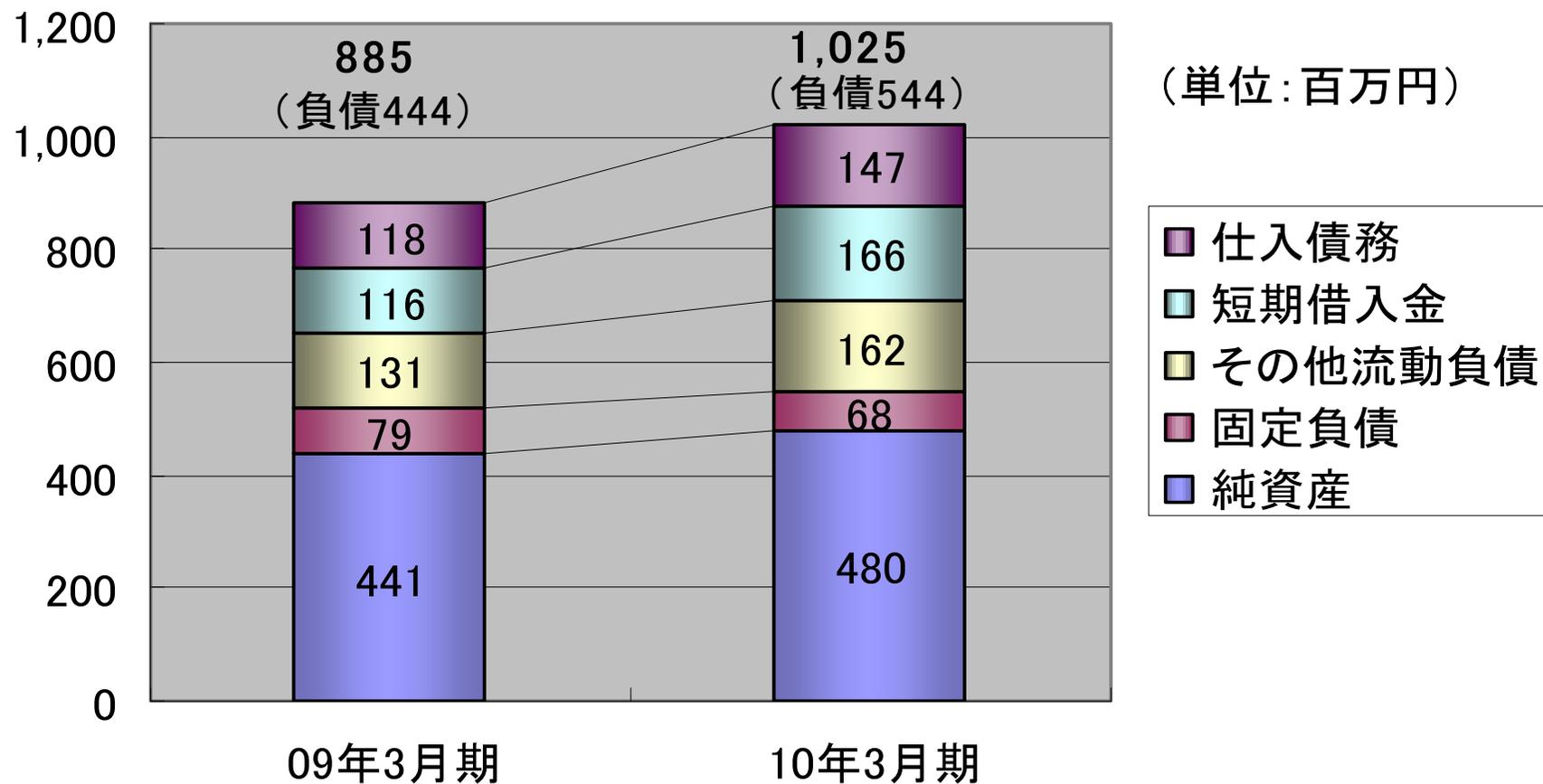
(単位:百万円)

	09/3期		10/3期		対前期比	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)	増減額	増減比 (%)
売上高	158	100.0%	1,151	100.0%	993	625.2%
売上総利益	△ 242	—	449	39.0%	691	—
販管費及び 一般管理費	397	251.3%	418	36.3%	21	5.5%
営業利益	△ 639	—	30	2.6%	669	—
経常利益	△ 661	—	41	3.6%	702	—
当期純利益	△ 673	—	39	3.4%	712	—

資産の状況



負債・資本の状況

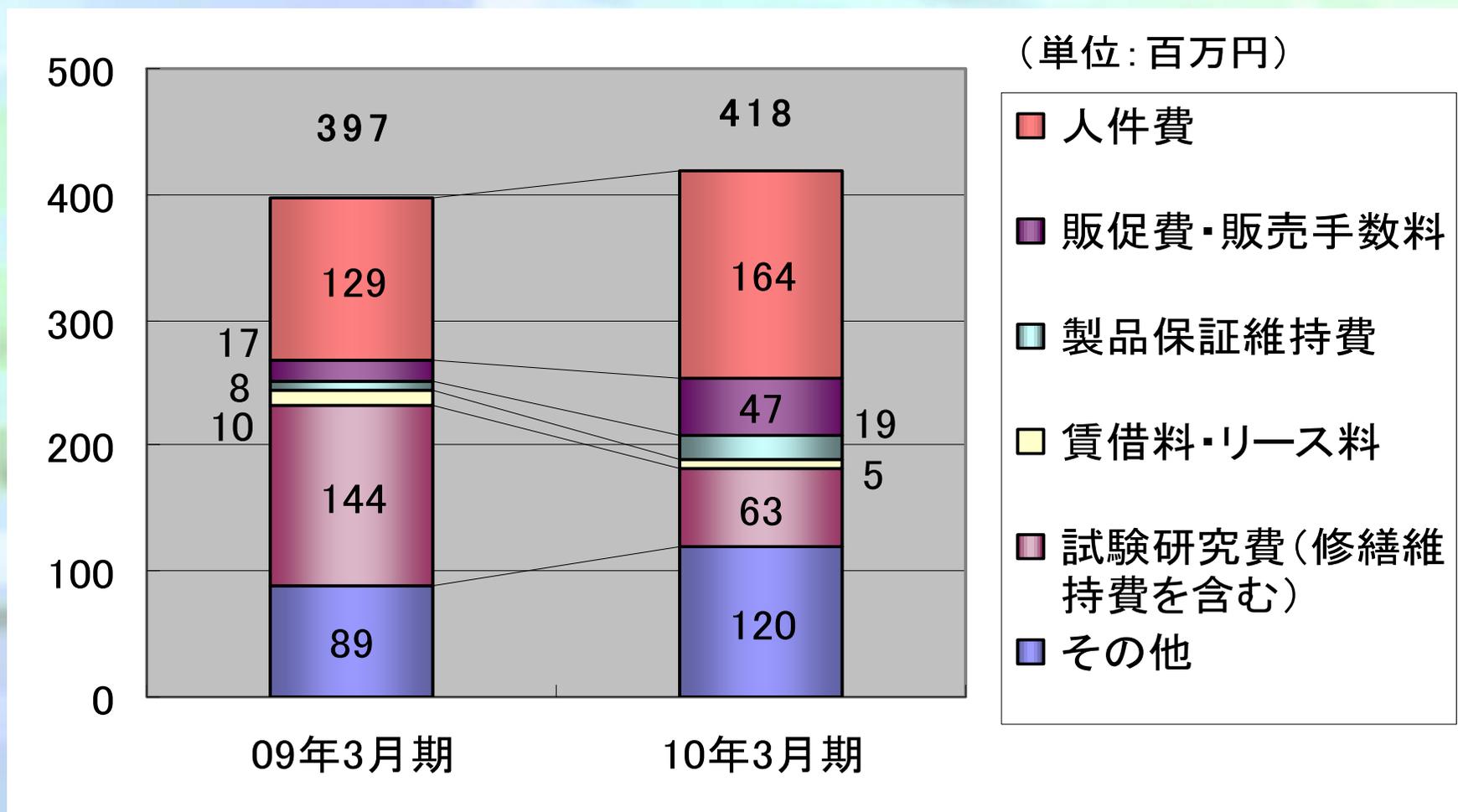


キャッシュフローの状況

(単位:百万円)

	09年3月期	10年3月期	増減
営業活動による キャッシュ・フロー	△ 345	△ 120	225
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 6	△ 4	2
財務活動による キャッシュ・フロー	80	33	△ 47
現金及び現金同等物 の増加額	△ 283	△ 88	195
現金及び現金同等物 の期末残高	208	119	△88

販管費の状況



2. 2011年3月期業績見通し

業績見通し

(単位:百万円)

	10/3期	11/3期予想	増減額	増減率	(参考) 09/3期
売上高	1,151	1,100	△ 51	△4.5%	158
営業利益	30	84	54	176.8%	△ 639
経常利益	41	81	40	93.1%	△ 661
当期純利益	39	78	39	97.8%	△ 673

※平成22年5月14日に公表した数値を使用しております。

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
イノベーション実用化開発助成事業

3. シームレスモールドステツパー シームレスモールドの開発

EBLITHO™装置の新しい市場開拓

Introduction:

シームレスモールドステッパーとは？

- ホロンの**EBLITHO™**装置技術を進化
- シームレス(繋ぎ目のない)のナノパターンをロール面に製作(マスターモールド)
- 高速で量産化に対応する技術を実現！

**半導体業界以外の新しい市場を開拓と、
ロール・ナノインプリント技術の実用化へ**

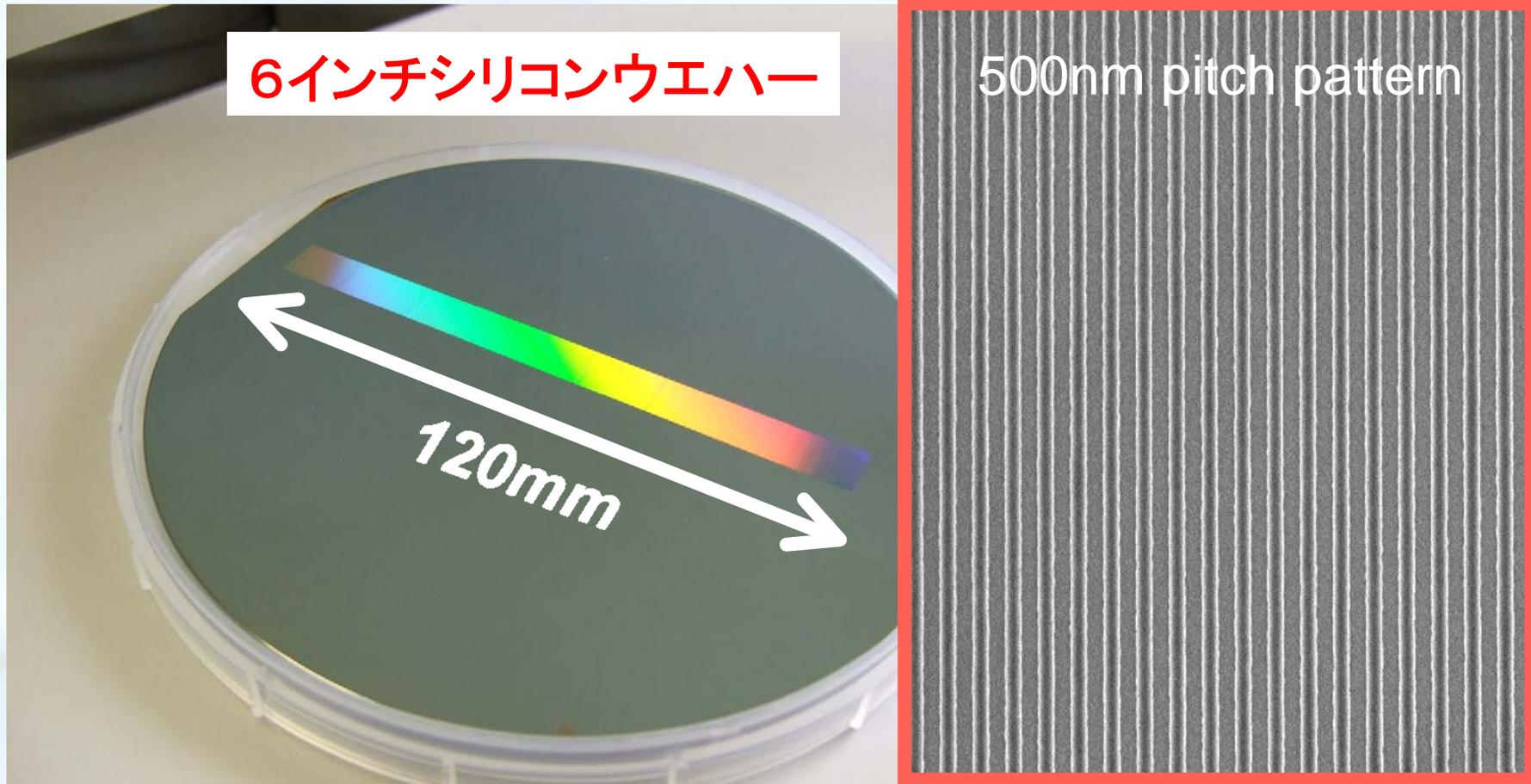
Introduction:

シームレスモールドが完成すると？

- **高機能フィルムを商品化**
- **量産コストを低減**
- **大量生産を実現**

**ロールツウロール・ナノインプリントによる
高機能ナノパターン製品が市場で商品化！**

平面基板上にシームレスラインを形成



10mm幅に200nm/500nmピッチ (20000本)を1回で製作

平成22年度の計画

1. ロールステージ及びロール露光装置の完成
2. ロールモールドの露光試験
 - パターン評価
 - スループット評価
3. フィルム転写試験
4. 総合評価

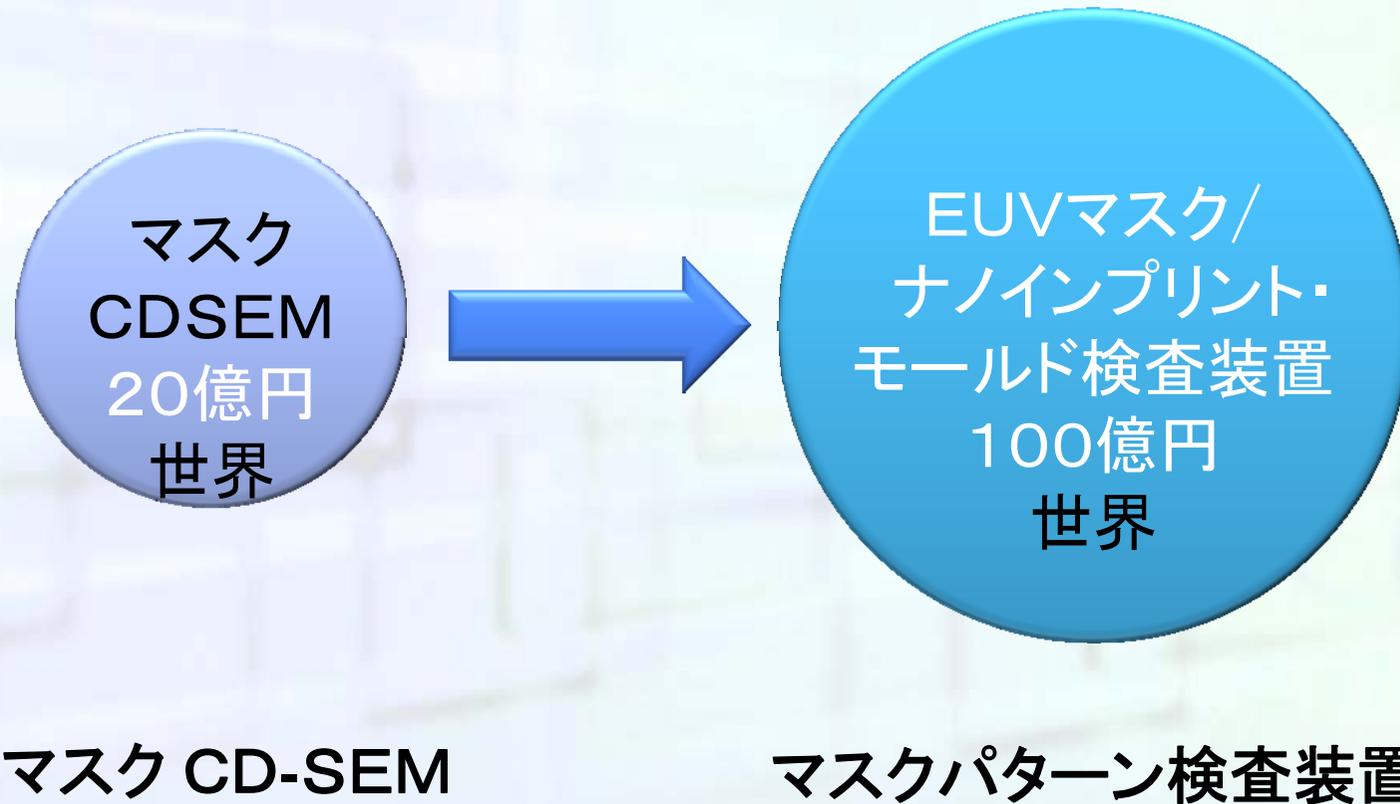
**直径100mm・長さ50mm
ナノパターン付シームレスモールドを実現する**

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
イノベーション実用化開発助成事業

4. 高速EB検査装置の新開発

マスク CD-SEMと新商品の市場規模比較

(金額は推定)



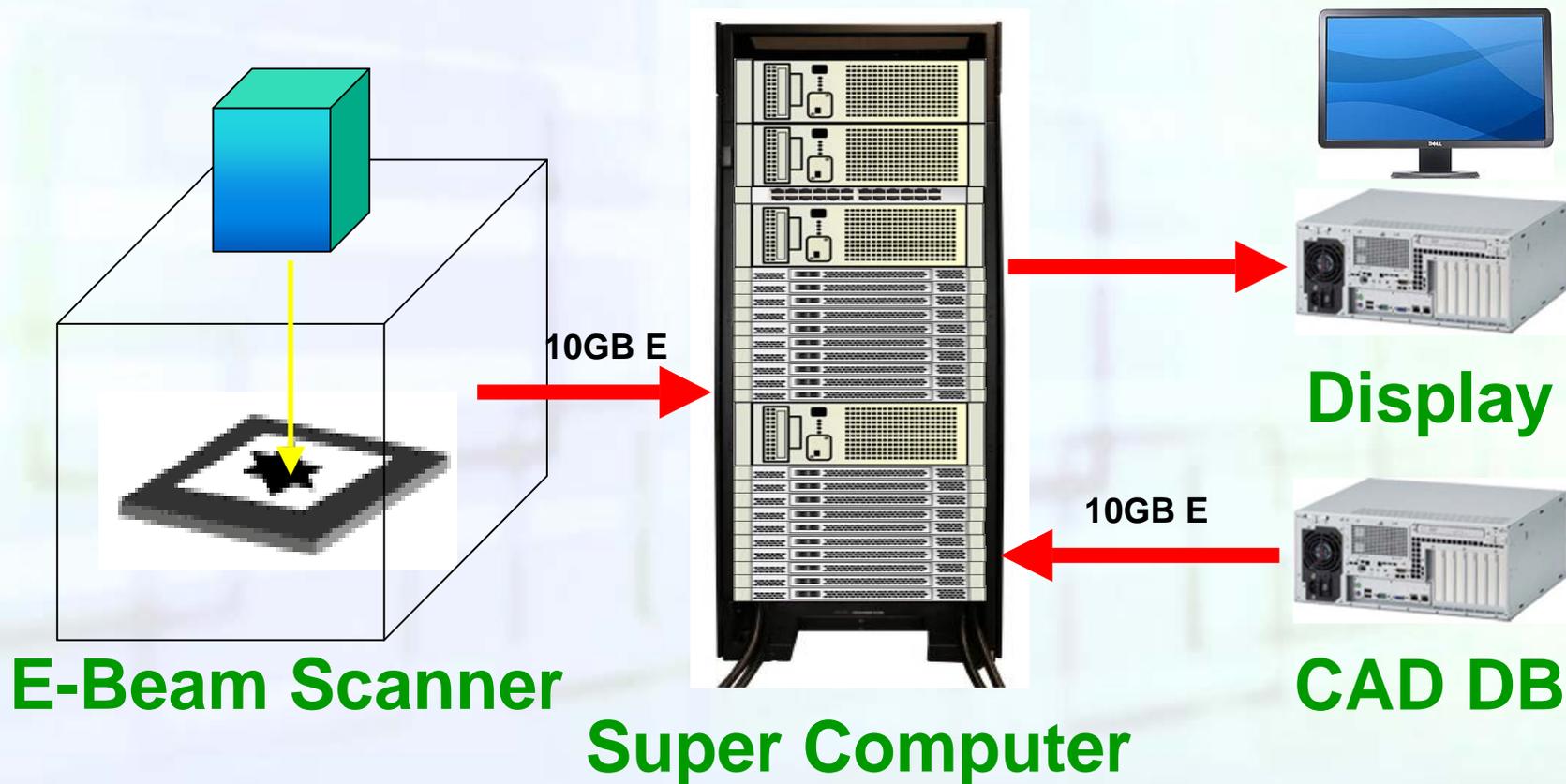
新規ビジネスへの参入領域

1. 紫外線レーザー方式で対応できない22nm以降の
マスク欠陥パターン検査
市場ニーズ: 2011年初めより
2. EUVマスクの開発/プリプロダクション/量産時の
欠陥パターンを検査
市場ニーズ: 2011年半ばより
3. ナノインプリント用モールド・パターン検査
市場ニーズ: 2012年初めより

新規参入の技術背景

1. 既存の紫外線レーザー方式マスクパターン検査装置では22nm以降、対応できなくなる。
2. 露光波長と同じ波長をもちいた光学式検査が必要。
EUV光源は未だ性能が不安定、非常に大型且つ、高額の装置となるなど実用的でない。
3. 市販の電子ビーム式検査装置は生産性が低い
4. CDSEMよりもマーケットサイズが大きい
5. 電子ビーム方式は将来有望的ある

システム構成



Die to Die & Die To Data Base

1. ホロンのコアテクノロジー

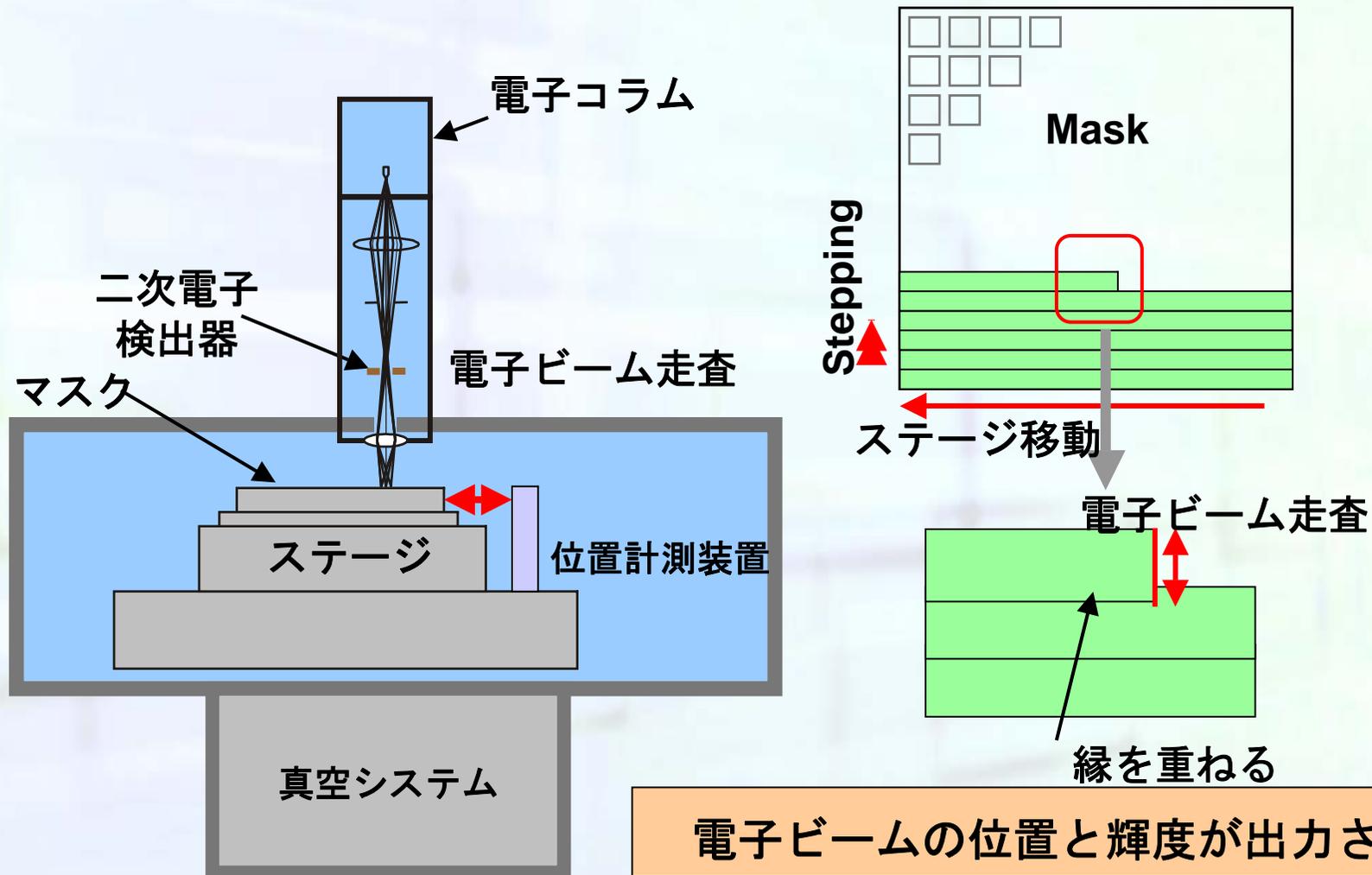
A: 収差補正技術

(小さなスポット径で大きな電流をえる技術)

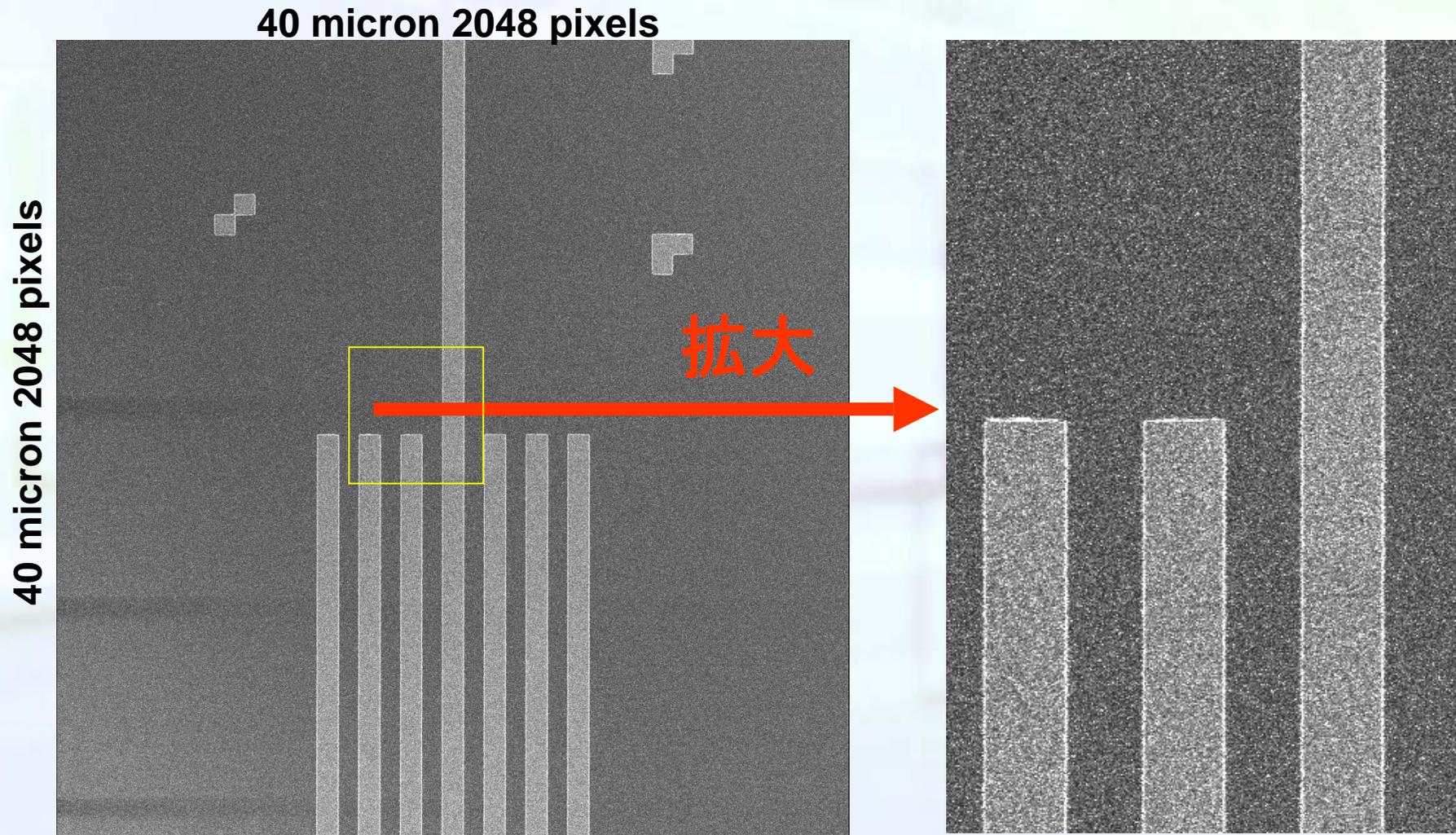
B: 低真空電荷抑制技術

C: 超高速連続SEM画像取得技術

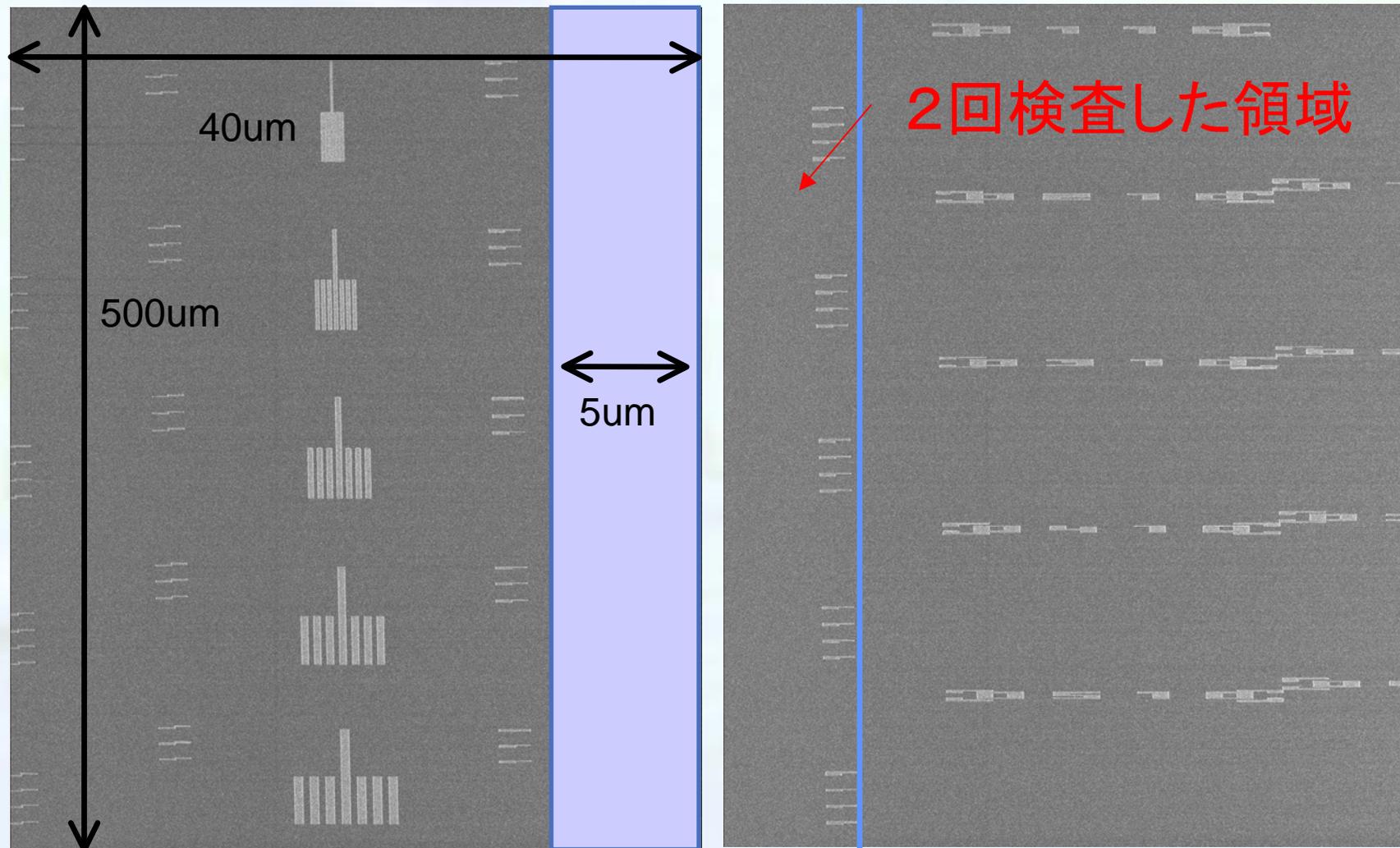
電子ビーム走査+ ステージ移動



超高速連続SEM画像取得結果



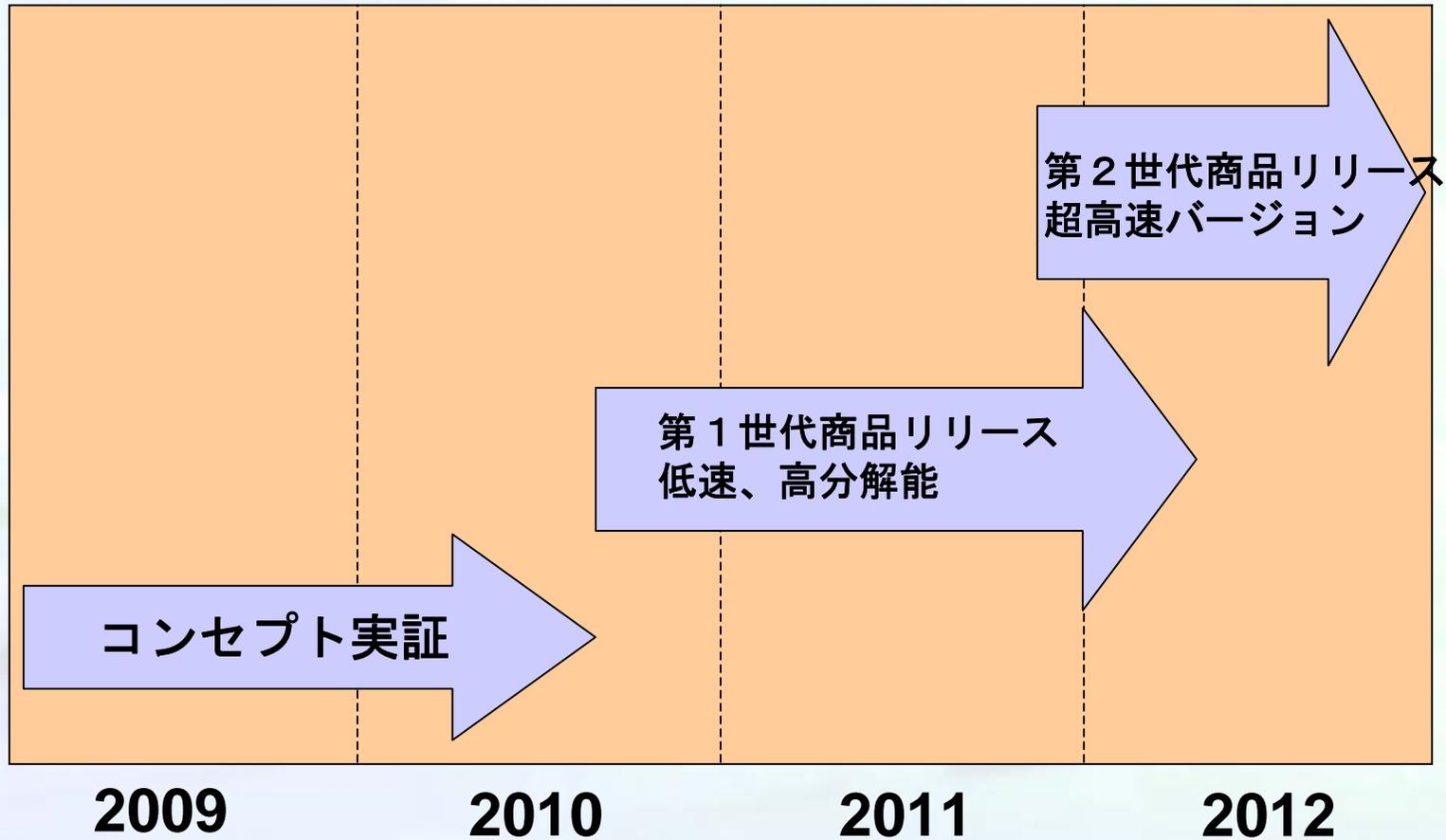
検査結果の再現性が高い



2. 開発装置のパフォーマンス予想

	フェーズ1	フェーズ2	フェーズ3
分解能	20nm	14nm	14nm
検査サイズ	100mm角	100mm角	100mm角
クロック数	100MHz	400MHz	400MHz
照射電流量	0.4nA	1.6nA	1.6nA
コラム数	1	1	2
測定時間	19.5時間	10.4時間	5.5時間

開発ロードマップ



業績見通しの開示について

- 本資料に記載されている内容は、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、下記のリスク等や不確定要因等を含んだものであることをご了承願います。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果に関わらず、常に株式会社ホロンが将来の見直しを見直すとは限りません。
- 当社の製品については国内販売については検収基準、海外については船積基準を原則として売上を計上しております。本資料における売上見込みは現時点での進捗見込みに基づくものであり、検収が遅れるリスクを含んでおります。
- また、当社を取り巻く経済情勢、株式市場動向等により、実際の業績等が経営目標その他の見通しと異なる結果となる可能性もあります。